



## **Вакуумная магнитодинамическая установка для литья под низким комбинированным давлением**

### **Назначение установки**

- ✓ Приготовление сплавов с расплавлением легирующих компонентов и одновременным перемешиванием сплава.
- ✓ Нагрев и терморегулирование жидкого сплава с его электромагнитным перемешиванием.
- ✓ Вакуумное рафинирование жидкого сплава с его электромагнитным перемешиванием.
- ✓ Модифицирование сплава с его электромагнитным перемешиванием.
- ✓ Регулируемая программная заливка сплава в литейную форму под воздействием электромагнитного давления.
- ✓ Кристаллизация отливки под комбинированным воздействием на кристаллизующийся сплав электромагнитного и пневматического давления.
- ✓ Терморегулирование жидкого сплава в тигле во время кристаллизации отливки.



### **Техническая характеристика**

Полезная емкость тигля, кг - 400

Производительность при заливке в форму (расход металла), кг/с, не меньше - 6

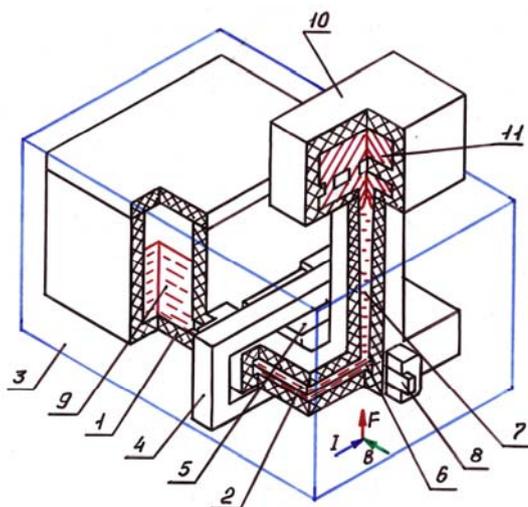
Максимальная температура металла, °С - 750

Мощность электромагнитной системы в режиме терморегулирования, кВт - 13

Вакуум для работы, кПа (мм. рт. ст) - 0,133 (1)

Максимальное пневматическое давление, кПа (кг/см<sup>2</sup>) - 50 (0,5)

Максимальное электромагнитное давление, кПа (кг/мм<sup>2</sup>) - 20 (0,2)



Установка оборудована процессором для контроля и регулирования параметров технологических процессов.

### **Схема установки:**

1 – тигель; 2 - кольцевой горизонтальный канал; 3 – камера; 4 - магнитопровод индуктора; 5 - катушка индуктора; 6 - рабочая зона; 7 – металлопровод; 8 - область влияния электромагнита; 9 - жидкий расплав; 10– кристаллизатор; 11 - затвердевшая отливка.